

武田 靖 弘 (タケダ ヤスヒロ)

本州化学工業株式会社社長



連結子会社“ハイビス社”（ドイツ）フル稼働となり 増収増益に貢献

◆当社の特徴と事業環境

■当社の特徴

当社は、1914年に和歌山市において創業して以来、フェノール誘導品に特化し国内外において事業を展開している。当社は、主原料のフェノールおよびメタパラクレゾールを三井化学から購入し、これを使用して各種のフェノール誘導品の製造を行い、顧客である樹脂、フォトレジスト、医薬品の各メーカーに中間原料として販売している。当社は、1988年にビスフェノールA事業を旧三井石油化学工業に譲渡したのを機に、ファインケミカル製品を主力とした事業構造への転換を図っており、また、バイエル社向け特殊ビスフェノールの生産販売拠点としてハイビス社をドイツに設立するなど海外への事業展開も積極的に行っている。

当社は、将来のマーケットにおいて自社の強みを発揮できる製品を特に「コア製品」※と位置付け、これを見だし、育成、強化・拡大を図っていくことを事業運営上の基本方針としている。

※「コア製品」とは、①成長する市場がある、②独自技術が活用できる、③世界のマーケットシェア1位または2位であることの3条件を満たす事業と位置付けており、現在は“ビスフェノール”、“特殊ビスフェノール”、“フォトレジスト材料”および“トリメチルフェノール”の4事業がある。

■コア製品の事業環境と当社の施策

●ビスフェノール〈液晶ポリマー（LCP）原料〉

ビスフェノールは、耐熱性、精密成形性に優れた“液晶ポリマー（LCP）”（パソコンや携帯電話等の電子部品に使用）の原料として、今後とも需要が拡大していくものと見込まれている。

2006年上期においては、IT関連製品の在庫調整完了を背景に国内需要の回復をみたものの、競合他社との競争激化による米国大手ユーザー向け販売の大幅減少により輸出が大きく落ち込むとともに、原料価格上昇に対応した価格改定が難航した。

2006年下期の見通しとしては、IT関連製品の在庫再調整の兆しがみられるものの国内需要はおおむね堅調に推移するものと予想されるが、輸出は競合他社とのさらなる競争激化により引き続き苦戦するものと見込まれるとともに、さらなる原料価格の値上げによる製造コストの上昇が懸念される。

このような事業環境の中で、今後、当社は、販売活動の強化（既存顧客での用途拡大に向けたバックアップとLCP以外の新規用途開拓）およびコストダウンの強化徹底（2006年7～9月にプラント合理化工事实施）を図るとともに、原料価格上昇に見合った価格改定の実現に向けて努力していくこととしている。

●特殊ビスフェノール（特殊ポリカーボネート樹脂・特殊エポキシ樹脂原料）

特殊ビスフェノールは、耐熱性、光学特性に優れた特殊ポリカーボネート樹脂や特殊エポキシ樹脂の原料として使用されており、特殊ポリカーボネート樹脂は自動車用部品や光学用電子部品向けに、特殊エポキシ樹脂はエポキシ封止剤・積層板向けに需要の増大が見込まれている。

現在、ハイビス社によるバイエル社への特殊ポリカーボネート樹脂の販売（2004年12月開始）が好調であり、フル稼働が続いている中で、当社は、今後の需要増大に対応するため、和歌山工場の既存プラント転用による増産（2007年7月本格稼働予定）を行うこととしている。また、特殊ビスフェノール事業のさらなる拡大を図るため、バイエル社向け以外の製品の開発と販売の促進に努めていくこととしている。

●フォトレジスト材料

フォトレジスト材料は、半導体、液晶ディスプレイ（LCD）の製造過程で使用されている。事業環境についていえば、半導体用フォトレジスト向けは、g/i線についていまだ根強い需要があるものの、ArF等への世代交代が進展しており、また、LCD用フォトレジスト向けは、高精細化に対応した高感度・高解像度のレジストのニーズが増大している。

このような事業環境の中で、当社は、半導体用についてはi線用材料の合理化促進とArF用材料の開発・拡販を、LCD用については当社の得意分野であるフェノール系材料の技術を生かして積極的に事業の推進（安価

材料の提供と新規顧客の獲得)を図っていくこととしている。

●トリメチルフェノール(ビタミンE原料)

メタパラクレゾールの誘導品であるビタミンE原料のトリメチルフェノールは、家畜飼料の添加剤として使用され、安定的な成長をしており、当社は、現在輸出を中心に事業を展開している。

ビタミンE市場は今後とも安定的に成長(年率3~5%程度)していくことが見込まれており、トリメチルフェノールの需要も引き続き伸長していくものと予想されるが、トリメチルフェノールの事業展開に当たっては、メタパラクレゾール誘導品全体としての利益最大化がキーポイントであるので、併せてパラクレゾール誘導品の販売強化が不可欠と考えている。

■新規事業の育成

今後の成長が期待される電子・情報材料用途分野における新規製品の育成を図るため、特に“感光性ポリイミド材料”、“液晶原料”、“シクロオレフィンモノマー”の生産販売に注力していくこととしている。

◆2007年3月期中間実績

■事業環境

IT関連機器やデジタル家電の在庫調整完了による需要回復を背景に国内向けビフェノールおよびフォトレジスト材料の需要が堅調に推移した。また、特殊ビスフェノールはパイエル社への自動車用途向けの販売が引き続き好調であり、トリメチルフェノールの販売も堅調であった。一方、収益圧迫要因として、米国での競合メーカーとの競争激化によるビフェノールの輸出不調や原材料価格のさらなる高騰があった。

■業績概要

●全般

売上高は95億34百万円(前年同期比18.9%増)、経常利益10億39百万円(同124.1%増)、中間純利益5億27百万円(同90.6%増)であった。

●部門別売上高

高機能樹脂原料部門は、ビフェノールの販売数量が減少したものの、ハイビス社による特殊ビスフェノールの販売数量が大幅に増加したため、売上高36.0億円(前年同期比17.6%増)となった。

高機能化学品部門は、フォトレジスト材料の販売数量が増加するとともに、トリメチルフェノールの販売数量も大幅に増加したため、売上高は49.7億円(同20.2%増)であった。

その他化成部品部門については、引き続きリセール製品の整理・削減をしたが、受託生産品の販売数量が増加したため、9.6億円(同17.3%増)となった。

総売上高の変動(同18.9%増の15.2億円増)要因は、価格差による1.9億円増と数量差による13.3億円増である。

●コア製品売上率

コア製品の総売上高に占める割合は、57%(前年同期比1ポイント増)となった。

●利益動向

経常利益は、当社単体ベースで7.3億円(前年同期比106.7%増)、連結ベースではハイビス社の業績拡大により10.4億円(同124.1%増)であった。

中間純利益は、当社単体ベースで4.3億円(同96.2%増)、連結ベースで5.3億円(同90.6%増)であった。

●貸借対照表

資産は前年同期と大きな変動はなく、負債・資本は借入金が増加する一方、資本が増加した。

株主資本比率は44.5%(前年同期40.6%)、D/Eは0.55(同0.76)であった。

●キャッシュフロー

営業活動によるキャッシュフローは、当社およびハイビス社いずれも大幅に増加したため、連結ベースで前年同期比6.2億円増加した。

投資活動によるキャッシュフローは、前年同期と比べ大きな変動はなかった。

財務活動によるキャッシュフローは、当社においては債権売却が大幅に減少し、ハイビス社においては借入金の返済により大幅に減少した。

◆2007年3月期 通期見通し

■2007年3月期下期の事業環境見通し

2006年上期の事業環境とほとんど変わらないものと予想される。原材料価格は、高止まりの状態が続くと見込まれるが、今後の動向が不透明であり、不安要因となっている。

■2007年3月期通期の業績見通し

●売上高187億円（前期比8.9%増）、経常利益18.5億円（同23.0%増）、当期純利益9.5億円（同4.4%増）となる見込みである。

●部門別売上高

高機能樹脂原料部門は、特殊ビスフェノールの販売好調により68.9億円（前期比10.7%増）、高機能化学品部門は、フォトレジスト材料およびトリメチルフェノールの販売増加により98.8億円（同8.7%増）、その他化成品部門は、受託製品の増加により19.3億円（同3.5%増）となる見込みである。

総売上高の変動（同8.9%増の15.2億円増）要因は、価格差3.8億円増と数量差11.4億円増である。

●コア製品売上率

コア製品の総売上高に占める割合は、57%（前期比1ポイント増）となる見込みである。

●利益動向

経常利益は、当社単体ベースで12.5億円（前期比1.2%増）、連結ベースではハイビス社の利益増加により18.5億円（同23.0%増）、当期純利益は、当社単体ベースで7.5億円（同0.8%減）、連結ベースで9.5億円（同4.4%増）となる見込みである。

●投資

投資は、18.2億円（当社17.6億円、ハイビス社0.6億円）、償却費は、15.0億円（当社10.9億円、ハイビス社4.1億円）となる見込みである。

●経営指標

2006年度は売上高187億円、総資産222億円、経常利益18.5億円、自己資本比率45%、D/E0.5となる見込みである。

2007年度は売上高195億円、総資産230億円、経常利益23億円（ROA10%）を目標としている。

（平成18年12月1日・東京）